

고보자력 NdFeB 박막의 자기적 특성

한국표준과학연구원 김만중*, 李瑛, 유권상, 김윤배
공주대학교 송창빈
충남대학교 김택기

Magnetic properties of high coercive NdFeB thin film

KRISS M.J. Kim*, Li Ying, K.S. Ryu, Y.B. Kim
Kongju Natioal Univ. C.B. Song
Chungnam National Univ. T.K. Kim

1. 서론

$Nd_2Fe_{14}B$ [1, 2]는 우수한 경자성 특성을 갖지만 취성이 강하므로 수백 μm 두께의 기계가공에 한계를 가진다. 그러므로 스팍터링 기술 등이 $Nd_2Fe_{14}B$ 박막 자석의 제조에 사용되었으며 제조된 고에너지 $Nd_2Fe_{14}B$ 박막은 micro-motor, MEMS 및 자기기록 매체 등에 잠재적 응용이 가능하다. 최근 Cadieu[3] 등에 의해 스팍터링[3]으로 제조된 $Nd_2Fe_{14}B$ 박막의 자기특성에 관한 연구가 진행된 이후 MBE[4] 및 laser ablation[5] 등에 의한 고보자력 박막 자석에 관한 많은 연구가 수행되어 있으며 이를 이용한 milli-size motor[6] 및 micro-patterning[7] 등에 관한 연구가 진행되고 있다.

본 연구에서는 Si 기판 위에 dc-rf sputtering 법을 이용하여 NdFeB 박막을 제조한 후 박막의 자기특성을 측정하였다.

2. 실험 방법

$Nd_{12}Fe_{82}B_6$, Nd와 Ta 타겟을 이용하여 dc-rf sputtering 법으로 Si 기판 위에 박막을 제조하였다. 스팍터링 중의 Ar 분압은 5×10^{-3} Torr 이었고 Si 기판 위에 Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta의 순서로 성막하였다. 이 박막을 450 ~ 650 °C에서 10분간 열처리하여 펄스마그네트미터로 약 8 T의 자장으로 착자한 후 진동시편마그네트미터로 자기특성을 측정하였다. 상분석 및 미세구조분석은 XRD, SEM 및 TEM 등에 의해 분석하였다.

3. 실험 결과 및 고찰

Fig. 1은 [Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta] 박막을 450 ~ 650 °C로 10분간 열처리한 박막의 자화곡선을 측정한 것이다. 450 °C 이상의 열처리 온도에서 경자성상이 출현하여 온도 증가에 따라 경자기 특성이 향상하여 620 °C에서 최적의 경자성을 보인다.

Fig. 2는 [Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta] 박막의 열처리 전과 후의 파단면의 SEM 이미지와 EDX 분석이다. 열처리 전에는 Si 기판 위에 Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta 5개의 층이 선명히 보인다. 또한 열처리 후에는 Nd/NdFeB/Nd의 3층이 확산하여 혼합되고 결정화되어 1개의 층으로 된다.

Fig. 3은 R([Nd/NdFeB]의 두께비)을 변화시킨 [Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta] 박막의 자화곡선이다. R=0인 박막은 α -Fe상에 의해 연자기 특성을 나타내며 $R \geq 1$ 인 다른 박막들은 20 kOe 이상의 고보자력의 자기 특성을 갖는다.

Fig. 4는 [Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta] 박막의 R에 따른 M_r/M_s 와 H_c 의 변화를 나타내고 있다. 이 경우 M_s 는 자화곡선상의 최고 자화값을 정했다. M_r/M_s 는 R에 따라 큰 변화가 없으며 보자력은 R=1에서 20 kOe로 급격한 증가 후 일정한 값을 유지한다.

이 실험에 의해서 [Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta] 박막을 650 °C에서 10분간 열처리하여 확산 및 결정화에 의해 고보자력의 자기특성을 갖는 박막을 얻었다. 또한 Nd/NdFeB의 두께비 ≥ 1 의 박막들에서 약 20 kOe의 고보자력의 우수한 경자기 특성을 나타낸다.

4. 참고문헌

- [1] M. Sagawa, S. Fujimura, H. Yamaoto, Y. Matsuura and K. Hirag, IEEE Trans. 20 (1984) 1584
- [2] J.J. Croat, J.F. Herbst, R.W. Lee and F.E. Pinkerton, J.Appl. Phys. 55 (1984) 2078
- [3] F.J. Cadieu, Phys., T.D. Cheung, L. Wickramasekara and N. Kamprath, IEEE Trans. Magn. 22

(1986) 752.

- [4] D.J. Keavney, E. E. Fullerton, J. E. Pearson, and S. D. Bader, *J. Appl. Phys.* 81, (1996) 4441
- [5] H. Lemke, C. Echer, and G. Thomas, *IEEE Trans. Magn.* 32 (1996) 4404.
- [6] S. Yamashita, J. Yamasaki, M. Ikeda and N. Iwabuchi, *J. Appl. Phys.* 70 (1991) 662
- [7] H. Lemke, T. Lang, T. Goddenhenrich and C. Heiden, *J. Magn. Magn. Mater.* 148 (1995) 426

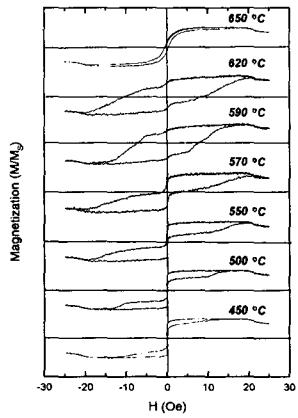


Fig. 1 Changes of hysteresis loops of [Ta/Nd/NdFeB/NdFeB/Nd/Ta] films for various annealing temperatures.

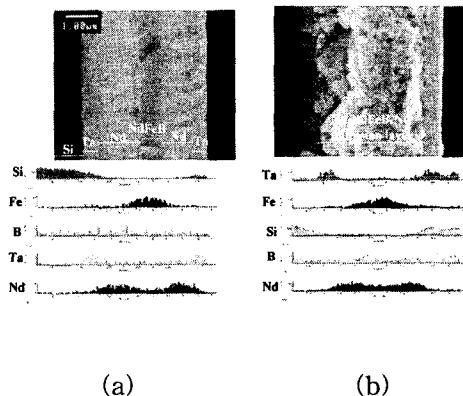


Fig. 2. SEM micrograph and EDX analysis of [Ta/Nd/NdFeB/Nd/Ta] thin films for the fractional surface before(a) and after(b) annealing.

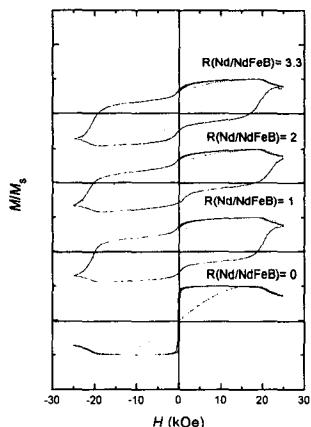


Fig. 3 Hysteresis loops measured parallel(solid lines) and perpendicular(dotted lines) to the film plane for the [Ta/Nd/NdFeB /Nd/Ta] thin films for various R.

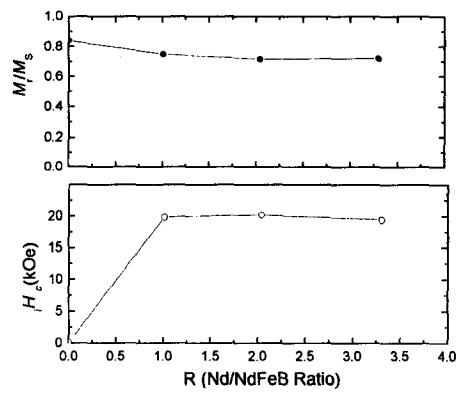


Fig. 4. The variation of M_r/M_s and H_c as a function of R, measured in film plane direction.